Simba™ SH606

全氟化彈性體密封件
Perfluoroelastomer

equator®

高潔淨耐高溫之泛用型全氟化產品
High purity & high temp. resistance FFKM product, general purpose

- 適合在NF3、O2、CF4等電漿環境下使用，比起一般高潔淨型產品，對於在嚴苛的化學及電漿環境下使用，擁有更為優異的表現
  Applied in NF3 or O2 CF4 plasma gas process.
  Compared with normal high purity products, it shown a remarkable and stable feature in plasma and chemical environment
- 各項特性均有優異的表現，適合廣泛使用在各式製程
  Excellent performance on every process.
- 優異的高溫回彈特性以及極高的建議連續使用溫度
  Excellent thermal elasticity maintenance capability and high continuous service temperature.
- 產品之最後包裝與清潔均於無塵室內完成
  Cleanroom packaging and cleaning.

特性與優點 FEATURE

優異的物理特性
Excellent physical property

良好的不沾粘性
Good non-stick characteristics

對各式電漿環境有極優良的抗性
Excellent resistance to plasma environment

對O2 NF3 等電漿環境有良好的抗性
Extremely O2 resistance and NF3 plasma stability

對各式化學溶劑有極優良的抗性
Excellent resistance to solvents and chemicals

優異最高連續使用溫度
Excellent continuous service temperature

典型物理特性 PROPERTY

硬度(Shore A)	75
顏色(Color)	Black
模數(100 % Modulus , Mpa)	5.7
拉伸強度(Tensile strength at Break, Mpa)	16.4
延伸率(Elongation at Break, %)	200
壓縮變形率(Compression set 70 hr @ 250℃)	21
建議最高連續使用溫度(Temp. , ℃)	330

建議應用位置 APPLIED POSITION

反應槽密封件(Chamber Seals)
管線接頭密封件(Fitting Seals)
氣體管線密封件(Gas Inlet/Outlet Pumping Line Seals)
閥件密封件(Valve Seals)

建議應用製程 APPLIED PROCESS

乾式蝕刻(Dry Etch)
濕式蝕刻(Wet Etch Acid,Base)
擴散(Diffusion)
離子植入(Ion Implant)
快速回火(RTP)
濕式去光阻(Wet Stripping Solvents)
濕式清潔(Wet Cleaning UPDI)

equator®
www.eqoring.com

RunSea Technology Co. Ltd
TEL : 886-3-5640969
FAX : 886-3-5640799
E-MAIL : info@runsea-t.com